

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年2月20日(20.02.2020)



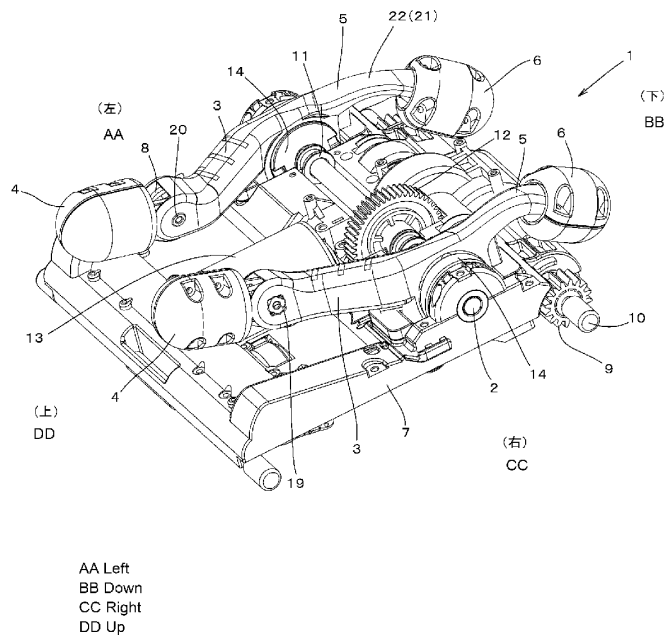
(10) 国際公開番号

WO 2020/035978 A1

- (51) 国際特許分類:
A61H 7/00 (2006.01) A61H 23/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/019690
- (22) 国際出願日: 2019年5月17日(17.05.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-153594 2018年8月17日(17.08.2018) JP
- (71) 出願人: 大東電機工業株式会社 (DAITO ELECTRIC MACHINE INDUSTRY COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒5798046 大阪府東大阪市昭和町9番11号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 田口 耕治 (TAGUCHI Koji); 〒5798046 大阪府東大阪市昭和町9番11号 大東電機工業株式会社内 Osaka (JP). 石川 哲也 (ISHIKAWA Tetsuya); 〒5798046 大阪府東大阪市昭和町9番11号 大東電機工業株式会社内 Osaka (JP). 清水 新策 (SHIMIZU Shinsaku); 〒5798046 大阪府東大阪市昭和町9番11号 大東電機工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 安田 幹雄 (YASUDA MIKIO); 〒5770066 大阪府東大阪市高井田本通7丁目7番19号 昌利ビル7・6階 安田岡本特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

(54) Title: MASSAGING DEVICE

(54) 発明の名称: マッサージ装置



(57) Abstract: Provided is a massaging device capable of applying a satisfactory massage while preventing, as much as possible, an excessively large load from being applied from the massaging head to the massage area of a user even when the massage area of the user comes strongly in contact with a massaging head, and further, comprising a structure having a function whereby an excessively large load applied to the massaging head becomes distributed, such that the occurrence of damage, or the like, to the massaging device per se, is reduced. This massaging device (1) comprises massaging heads (4,

[続葉有]

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

6) for massaging the massage area of the user, and arm members (3, 5) having respective massaging heads (4, 6) mounted at forward ends thereof. The massaging device (1) is configured such that each of the arm members (3, 5) is provided with a load reduction mechanism (21) for absorbing the load applied from the massaging head (4, 6) toward the arm members (3, 5). The load reduction mechanism (21) uses a biasing force along a forward-backward direction to absorb the load applied to the massaging heads (4, 6).

(57) 要約: 使用者の施療部が施療子に強く接した場合であっても、使用者の施療部に対して施療子から過大な負荷が加えられることを可及的に防止すると共に、好適なマッサージを付与可能とし、更には、施療子に対して付与された過大な負荷を分散させる機能を有し、マッサージ装置自体の破損等を軽減するような構造を備えたマッサージ装置を提供する。本発明のマッサージ装置(1)は、使用者の施療部を施療する施療子(4、6)と、施療子(4、6)が先端に取り付けられたアーム部材(3、5)と、を備えたマッサージ装置(1)であって、アーム部材(3、5)には、施療子(4、6)からアーム部材(3、5)側に加わる負荷を吸収する負荷軽減機構(21)が設けられており、負荷軽減機構(21)は、前後方向に沿った付勢力を利用して施療子(4、6)への負荷を吸収する構成とされている。